【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年3月22日(2012.3.22)

【公開番号】特開2009-231271(P2009-231271A)
【公開日】平成21年10月8日(2009.10.8)
【年通号数】公開・登録公報2009-040
【出願番号】特願2009-26423(P2009-26423)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｈ　 1/46　　 (2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/3065　 (2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/205　　(2006.01)
Ｃ２３Ｃ　16/511　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｈ　 1/46　　　　Ｂ
Ｈ０１Ｌ　21/302　１０１Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/205
Ｃ２３Ｃ　16/511

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月2日(2012.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部開口を有する処理容器と、
　下面に厚み寸法が連続的に変化するように傾斜する傾斜面を有し、前記処理容器の上部開口を閉鎖するように配置される誘電体と、
　前記誘電体の上面に配置され、前記誘電体にマイクロ波を供給して前記誘電体の下面にプラズマを発生させるアンテナとを備え、
　前記アンテナは、前記傾斜面の鉛直上方に位置する複数のスロットを有する、プラズマ処理装置。
【請求項２】
前記誘電体の下面には、内周側壁面および外周側壁面が前記傾斜面であるリング形状の凹溝が形成されており、
　前記スロットは、前記内周側壁面および前記外周側壁面それぞれの鉛直上方に位置する、請求項１に記載のプラズマ処理装置。
【請求項３】
前記スロットは、中央部領域の鉛直上方に位置する第１のスロット群と、前記内周側壁面の鉛直上方に位置する第２のスロット群と、前記凹溝の底壁の鉛直上方に位置する第３のスロット群と、前記外周側壁面の鉛直上方に位置する第４のスロット群とに区分されている、請求項２に記載のプラズマ処理装置。